

セミナーのご案内

テーマ
Theme

ラインエッジラフネス計測SEMIスタンダード P47の改訂活動状況

Revision of P47 : Test method for Evaluation of Line-Edge Roughness and Linewidth Roughness

聴講無料
Free

日時
Date and time

12月12日(木) Thu., Dec. 12 13:40~14:30

会場
Venue

限定60席・直接会場(出展者セミナールーム[西1ホール])へお越し下さい。

Limited to 60 seats / Please come directly to the venue (Exhibitor Seminar Room : West Hall 1)

講演
Lecturer

山口敦子

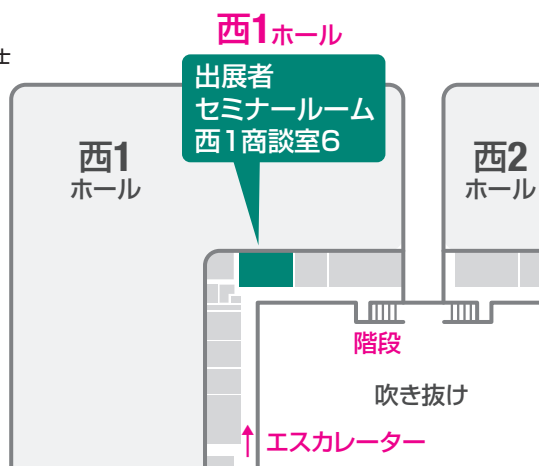
株式会社日立製作所 研究開発グループ
エレクトロニクスイノベーションセンタ 主管研究員 理学博士
Hitachi, Ltd. Research & Development Group
Chief Researcher Center for Technology Innovation - Electronics

Atsuko Yamaguchi Ph.D.

概要
Outline

レジスト及びプロセス評価の重要指標であるLER/LWRの標準的な計測手順(SEMIP47)が2007年に承認されました。その後LER/LWRの値自体が低減され、相対的に画像ノイズの影響が大きくなっています。また、新評価指標も提案されており、これらの問題に取り組むP47改訂タスクフォースの活動をご紹介します。

LER is an important index for device manufacturing. A standard procedure for the measurement (SEMI-P47) was established, but the value has been scaled and image-noise-caused error becomes serious. We will report P47 revision taskforce activity on this topic with an introduction to a new index.



ハッピーアワーのご案内



日時
Date and time

12月12日(木) Thu., Dec. 12
16:00~17:00

会場
Venue

日立ハイテクノロジーズブース
Hitachi High-Technologies Corporation Booth

ブース
NO. 南1ホール 7527

South 1 Hall No. 7527

日立ハイテクノロジーズは、日頃の感謝込めてハッピーアワーを開催致します。各種アルコール、ノンアルコールドリンクやオードブルをご用意しておりますので、この機会に是非ハイテックブースへお立ち寄りください。

We are pleased to invite our Semicon guests to "the Hitachi High-Technologies Happy Hour" in late afternoon on the day2, 16:00-17:00 of Thursday Dec. 12. Please feel free to enjoy alcoholic or nonalcoholic drinks with light snacks at our Semicon Booth, NO. 7527 the South 1 Hall.

